偏压及测试环境对离子束 DLC 膜 摩擦学行为的影响

赵博通^{1,2},代 伟¹,柯培玲¹,汪爱英^{1*}

(1. 中国科学院 宁波材料技术与工程研究所,浙江 宁波 315201;

2. 中国科学院研究生院,北京 100049)

摘 要:采用线性阳极层离子束技术制备了类金刚石薄膜(DLC 膜),研究了不同衬底负偏压和测试环境对 DLC 薄 膜摩擦学性能的影响.结果表明:在 - 50V 偏压下,薄膜硬度和弹性模量最大,这主要与薄膜中高的 sp³ 含量相关; 衬底负偏压对薄膜在室温大气条件下的摩擦学性能影响不显著,薄膜总体呈现较低的摩擦系数和磨损率,显示出优 异的抗磨损性能;线性离子束制备的含氢 DLC 薄膜的摩擦学行为受湿度及环境气氛影响较大,归因于环境中的氧 气和水分造成的摩擦化学反应.

文章编号:1004-0595(2011)05-0510-05

Effect of Bias and Environment on the Tribological Behavior of Diamond – like Carbon Films by Linear Ion Source

ZHAO Bo - tong^{1,2}, DAI Wei¹, KE Pei - ling¹, WANG Ai - ying^{1*}

(1. Ningbo Institute of Material Technology & Engineering, Chinese Academy of Sciences, Ningbo 315201, China
 2. Graduate University of Chinese Academy of Science, Beijing 100049, China)

Abstract: Diamond – like carbon films were deposited on p - Si(100) substrates by a linear anode layer ion beam system using the precursor gas of methane. Effects of the substrate negative bias and the testing environment on the tribological behaviors of the films were considered. Results show that hardness and elastic modulus reached their maximum at the substrate bias of -50 V. When testing in ambient air, films prepared at various substrate bias exhibited good anti – wear property, and there was no significant difference between their tribological behaviors. Also, friction coefficients were very sensitive to the testing environment, mainly as a result of the tribochemical reaction at the tribological interface. **Key words**: linear anode layer ion source, DLC, substrate negative bias, tribology

类金刚石碳膜(DLC),是1类由碳 sp²杂化键和 sp³杂化键组成、还可能包含有 H 或者其他元素 掺杂的亚稳态无定型碳材料.这种独特的结构使得 DLC 具有高的硬度、化学惰性、光学透过性以及良 好的生物相容性等优异特性^[1],作为1类新型保护 性涂层,在磁记录介质、汽车部件、光学窗口等多种 领域得到了部分成功应用^[2].然而,由于 DLC 薄膜 覆盖了很宽的化学结构和成份范围,在不同温度、湿

Received 5 January 2011, revised 29 March 2011, accepted 17 May 2011, available online 28 November 2011.

^{*} Corresponding author. E - mail:aywang@ nimte. ac. cn, Tel: +86 - 574 - 86685170.

The project was supported by the NSFC Young Scientists Fund (51005226) and Ningbo Natural Science Foundation (2010A610161) and Open Fund of State Key Laboratory of Solid Lubrication (0906).

国家自然科学青年基金项目(51005226)、宁波市自然科学基金项目(2010A610161)、固体润滑国家重点实验室开放基金项目(0906)资助.

度、真空等环境中,摩擦系数可以在 0.003~1.000 的范围内变化,这极大限制了 DLC 薄膜的广泛应 用.目前,针对不同应用环境,纳米多层、纳米复合和 表面织构化等多种方法,都被相继用于探索具有更 优异、稳定摩擦学性能的 DLC 薄膜^[3].

DLC 薄膜的结构和性能在很大程度上取决于 制备技术与工艺.目前,制备 DLC 薄膜的方法主要 有离子束、阴极真空电弧、PECVD、脉冲激光沉积、 磁控溅射、离子束辅助磁控溅射等各种方法.其中, 线性阳极层离子源(LIS)技术是近年发展起来的可 用于制备含氢类金刚石薄膜(a-C:H)的1种无网 格离子源技术.作为封闭漂移离子源的1种^[4],该离 子源由前苏联时期为卫星等航天器的电驱动而研发 的霍尔效应推进器^[5]演变而来.无需加速网格和中 和电子枪的设计,可以在反应性气体中运行,能够在 较大面积上获得均匀的离子束,基材适用范围广,这 使得阳极层离子源非常适用于大规模的工业应 用^[6].然而,目前该离子源多应用于光电功能薄膜 等的基片预清洗过程中,直接利用其进行 DLC 薄膜 沉积的研究很少.

前期我们考察了 LIS 技术制备的 DLC 薄膜的 结构和力学性能^[7],本文在此基础上,重点对以 CH₄ 为碳源气体不同偏压、不同测试环境下的 DLC 薄膜 的摩擦学行为进行了研究,结合 DLC 薄膜的摩擦界 面形貌与磨屑化学组成的分析,剖析了相关的摩擦 磨损机理.

1 实验部分

1.1 样品制备

采用韩国 JNL Tech 公司生产的线性阳极层离 子源制备 DLC 薄膜,具体的真空沉积设备结构示意 图见文献[7]. 首先,将厚度为(545±5) μm 的 p(100)单晶硅基片在丙酮溶液中超声清洗 5 min, 烘干,放入真空腔内. 抽真空至腔内气压为 2.67 × 10⁻³ Pa 后,向腔内通入 Ar 气,并开启 LIS 和偏压电 源对基片刻蚀 10 min. 然后通入 CH₄ 沉积 DLC 薄 膜,在刻蚀及薄膜沉积过程中,基片随样品架自转转 动. 腔内工作气压约为 2.67 × 10⁻¹ Pa. 所施加的衬 底负偏压均为频率 350 kHz、占空比 61.5% 的直流 脉冲负偏压. 具体的工艺参数见表 1. 为减少制备薄 膜厚度对后续性能研究过程中的影响,在不同负偏 压下,我们先沉积了 20 min 的薄膜,并以其来计算 相应偏压下的薄膜平均沉积速率,再按照沉积速率 来调控薄膜沉积时间,以便制备相似厚度的 DLC 薄 膜进行研究.本试验中控制 DLC 薄膜的厚度约为 300 nm.

表 1 阳极层离子束制备 DLC 薄膜的工艺参数

Table 1 Deposition

parameters of DLC films by LIS system

Deposition	Cleaning	Deposition
parameters	process	process
Ar / sccm	40	0
CH_4 / sccm	0	40
Ion Source Current / A	0.2	0.2
Negative substrate bias / V	100	0,50,100,200,350
Deposition time / min	10	Varies with deposition rates

1.2 测试方法

采用 Alpha – Step IQ 型表面轮廓仪测量薄膜的 厚度,薄膜厚度由相对于衬底测得的刻蚀深度以及 薄膜高度相加得到. 用美国 MTS 公司制造的 NANO G200 型纳米压痕仪测量薄膜的硬度和弹性模量,压 入深度为 500 nm,取压入深度为薄膜厚度 1/10 处 的 6 个测点的平均值. 采用 X 射线光电子能谱 (XPS)和激光拉曼光谱仪(HORIBA JY LabRAM HR800)分别测量薄膜中的碳键. XPS 选用能量为 1 486.6 eV、分辨率为0.48 eV 的单色化 Al Kα 射线 源;Raman 测试中使用波长为 532.2 nm 的掺钕钇铝 石榴石激光,采集范围为 600 ~ 2 000 cm⁻¹,采集时 间120 s;采集的谱图均使用开源通用分峰软件 Fityk 进行了分峰拟合.

用 JLTB - 02 型球盘式摩擦磨损试验机测试不 同衬底负偏压下 DLC 薄膜在室温大气条件下的摩 擦学性能.用 TRB - S - D - 0000 型(CSM)摩擦磨损 试验机测试了在 100 V 衬底负偏压下 DLC 薄膜在 N₂、不同相对湿度的空气、水润滑以及油润滑条件 下的摩擦学性能.试验条件为载荷 3 N、旋转半径为 3 mm、线速度 200 mm/s,行程 500 m、摩擦对偶为 φ6 mm和硬度不小于 HRC60 的 SUJ2/GCr15 轴承钢 球.根据磨痕深度和磨斑直径计算了薄膜和对摩球 的磨损率.

利用场发射扫描电镜(SEM)及附带的能谱仪 (EDS)、Raman 光谱仪,对 DLC 薄膜及对摩球的磨 痕形貌及成份变化进行了分析.

2 结果与讨论

2.1 薄膜的基本特性

图 1 为随衬底负偏压增加,薄膜的硬度及弹性 模量先升高后降低的曲线,在 - 50 V 时分别达到 18.30 和146.0 GPa 的最大值;图2 为随着衬底负偏 压的增加,由薄膜 XPS C1s 谱分峰拟合^[8-9]得到的 薄膜中 sp³ 含量的变化,趋势同样为先升高后降低, 在 -50 V 时达到 29.26% 的最大值;图 3 为 Raman 谱分峰拟合得到的 G 峰位置及 *I*(D)/*I*(G) 的变



 Fig. 1 Hardness and elastic modulus of DLC films as a function of negative substrate bias
 图 1 衬底负偏压对 DLC 薄膜硬度及弹性模量的影响



图 2 XPS 所得 sp³ 含量

化,趋势为先降低后升高,与 XPS 所得的 sp³ 含量变 化趋势互为验证^[10].考虑到阳极层离子源出射的离 子具有约对应于放电电压一半的能量^[11]以及衬底 负偏压对离子基团的加速作用^[12],根据 DLC 薄膜 沉积的亚植入模型^[1],当离子能量高于每 C 原子 100 eV 时,在薄膜沉积过程中将发生 sp³ 键向 sp² 键的转化,从而导致薄膜硬度及弹性模量的下降.

2.2 薄膜的摩擦学性能

2.2.1 衬底负偏压对摩擦学性能的影响

在室温大气条件下,DLC 膜的摩擦系数和磨损 率随衬底负偏压的变化如图 4 所示.0 V 偏压下,薄 膜的摩擦系数高达 0.28;偏压为 - 50 ~ - 350 V 时, DLC 薄膜的摩擦系数保持在 0.12~0.15, 磨损率为 5.28~7.28×10⁻⁸ mm³/(Nm),具有优异的抗磨损 性能.以-100 V 偏压下沉积的薄膜为例(如图 5) 分析摩擦界面的形貌和成份变化,在对摩球的磨斑 表面上,覆盖有一定量的黑色转移层;在薄膜的磨痕 两侧则分布有少量磨屑.与 DLC 薄膜相比, 磨屑的 Raman 谱 G 峰位置和 *I*(D)/*I*(G)略有增加,表现出 石墨化的趋势. EDS 能谱[图 5(c)]分析表明磨屑 主要组成成份为 C、O、Fe.



fitted by Raman spectrum 图 3 经 Raman 光谱拟合 得到的 DLC 薄膜 G 峰位置和 *I*(D)/*I*(G) 值



Fig. 4 Average friction coefficient and wear rate of DLC films under ambient Air 图 4 不同偏压下 DLC 薄膜在大气下的平均摩擦系数及磨损率

可以推测,在摩擦界面处形成了附着于对摩球 磨斑部分表面的转移层.薄膜、对摩球以及空气中的 氧气和水分之间发生的摩擦化学反应^[13]使得转移 层在相对湿度约为60%~80%的环境下不能稳定 存在,从而导致薄膜摩擦系数不稳定,且平均值大于 0.1.0V偏压下,一方面入射碳氢基团可能受衬底







上电荷积累的影响,另一方面离子能量没有脉冲偏 压作用下的时域变化,还需要后续试验来分析导致 其较高摩擦系数和磨损率的沉积过程和结构特点. 偏压为-50~-350 V时,薄膜的摩擦系数和磨损 率随偏压变化幅度不大,其趋势与薄膜和对摩球之 间的初始赫兹接触半径的变化趋势类似,摩擦学行 为主要由初始接触状态也即薄膜的力学性能所决 定,推测原因认为在相同测试环境下,薄膜成份随偏 压的变化不足以改变摩擦化学反应.

2.2.2 不同测试环境对摩擦学性能的影响

(a) Wear track

图 6 为 - 100 V 偏压下制备的 DLC 薄膜在 N₂, 20%、50%、80% 湿度,水以及油润滑下的摩擦系数 和磨损率.由图 6 可以看出:在 N₂ 惰性气氛、水润滑





和油润滑条件下,薄膜具有较低的摩擦系数,平均值 均小于0.1,尤其在N₂ 气氛下,摩擦系数降至0.01 以下.在20%相对湿度下,摩擦系数约为0.08;随湿 度增加到50%,薄膜的摩擦系数增加显著;湿度增 至80%时,摩擦系数则略有下降.薄膜在各测试环 境下均显示出良好的抗磨减摩作用.在 N_2 气氛下, DLC 薄膜的磨损率为 3.72×10⁻⁹ mm³/(Nm);在湿 度以及水润滑条件下,磨损率随环境中水份的增加 由 3.10×10⁻⁸升高到 5.06×10⁻⁸ mm³/(Nm);在油 润滑条件下观察不到磨损现象.图 7 为各环境下对 摩球的磨斑形貌.磨斑均不同程度的被转移层覆盖. N_2 环境下的转移层显得比较完整和致密[图 7 (a)],其他环境下均为部分覆盖[图7(b~d)].

一方面对摩球的主要成份是 Fe,有利于摩擦界 面上转移层的形成;另一方面化学惰性的 N₂ 气氛不 利于摩擦化学反应的发生,对转移层起到了保护作 用,因而在 N₂ 气氛下薄膜具有非常低的摩擦系数和 磨损率.根据估算^[14]在介质为液体石蜡的油润滑条 件下,一定程度上发生了流体动压润滑,因此摩擦系 数较低,薄膜及对摩球上也没有观察到磨屑及磨痕 的产生;对于液态水,其流体润滑作用并不明显,与 水蒸汽的主要区别体现在液态水隔绝了摩擦界面与 空气的接触,可能由于氧气的缺乏而影响了摩擦化 学反应,因此水润滑条件下薄膜的摩擦系数较湿度 环境下更低.

综上,线性离子束制备的 DLC 薄膜的摩擦学行 为与传统含氢 DLC 薄膜相似,都对湿度及环境气氛 有较强的依赖关系.在大气环境下薄膜摩擦系数较 高,而在惰性 N₂条件下薄膜则具有非常低的摩擦系 数.环境中氧气和水的含量越大,摩擦系数越大.这 是由于摩擦界面上形成的转移层在不同测试环境中 受到薄膜、对摩球以及环境中的氧气和水份之间的 摩擦化学反应的影响,与大多数研究者的结论相符 合^[3,13,15].

3 结论

a. 在-50 V偏压下,薄膜具有最高的硬度和



(a) N₂
 (b) 20% humidity
 (c) 50% humidity
 (d) 80% humidity
 Fig. 7 Surface morphology of wear scar of counter ball at various test environment
 图 7 不同摩擦测试环境下对摩球的磨斑形貌

弹性模量,这与薄膜中最高的 sp³ 含量密切相关.

b. 衬底负偏压对薄膜在室温大气条件下的摩 擦学性能没有显著的影响,薄膜具有较低的摩擦系 数和磨损率,显示出良好的抗磨减摩作用.

c. 线性离子束制备的含氢 DLC 薄膜的摩擦学 行为对湿度及环境气氛等比较敏感,主要归因于摩 擦过程中,摩擦界面与环境中的氧气和水分发生的 摩擦化学反应.

参考文献:

- [1] Robertson J. Diamond like amorphous carbon [J]. Materials Science and Engineering: R: Reports, 2002, 37(4-6):129 – 281.
- Hauert R. An overview on the tribological behavior of diamond like carbon in technical and medical applications
 [J]. Tribology International, 2004, 37 (11 12): 991 1 003.
- [3] Erdemir A, Donnet C. Tribology of diamond like carbon films: recent progress and future prospects [J]. Journal of Physics D: Applied Physics, 2006, 39(18): R311 – R327.
- [4] Zhurin V V, Kaufman H R, Robinson R S. Physics of closed drift thrusters [J]. Plasma Sources Science and Technology, 1999, 8(1): R1 – R20.
- [5] Zharinov A V, Popov Y S. Acceleration of plasmaby a closed Hall current [J]. Soviet Physics - Technical Physics, 1967, 12(2): 208-211.
- [6] Shaballin A, Amann M, Kishinevsky M, et al. Industrial ion sources and their application for DLC coating [C]. The Society of Vacuum Coaters 42nd Annual Technical Conference Proceedings, 1999: 338 – 341.
- [7] Dai W, Wu G S, Sun L L, et al, Effect of substrate bias on microstructure and properties of diamond – like carbon films by linear ion beam system [J]. Chinese Journal of Materials

Research, 2009, 23(6): 598-603 (in Chinese)[代伟,吴国松,孙丽丽,等,村底负偏压对线性离子束 DLC 膜的微结构和物性的影响[J].材料研究学报,2009,23(6):598-603].

- [8] Haerle R, Riedo E, Pasquarello A, et al. sp²/sp³ hybridization ratio in amorphous carbon from C1s core – level shifts: X – ray photoelectron spectroscopy and first – principles calculation[J]. Physical Review B, 2001, 65(4):045101.
- [9] Rybachuk M, Bell J. The effect of sp² fraction and bonding disorder on micro mechanical and electronic properties of a C:H films[J]. Thin Solid Films,2007,515(20-21):7 855 7 860.
- [10] Ferrari A, Robertson J. Interpretation of Raman spectra of disordered and amorphous carbon [J]. Physical Review B, 2000, 61(20): 14 095 - 14 107.
- [11] Burtner D, Blacker R, Keem J, et al. Linear anode layer ion sources with 340 – and 1500 – mm Beams [C]. the Society of Vacuum Coaters 46th Annual Technical Conference Proceedings, 2003: 263 – 268.
- [12] Barnat E, Lu T. Calculated sheath dynamics under the influence of an asymmetrically pulsed dc bias [J]. Physical Review E, 2002, 66(5):056401.
- [13] Li H, Xu T, Wang C, et al. Friction induced physical and chemical interactions among diamond – like carbon film, steel ball and water and/or oxygen molecules [J]. Diamond and Related Materials, 2006, 15(9): 1 228 – 1 234.
- [14] Hamrock B, Dowson D. Isothermal elastohydrodynamic lubrication of point contacts. III – Fully flooded results [J]. Journal of Lubrication Technology, 1977, 99(2): 264 – 276.
- [15] Wang C B, Li H X, Xu T. Tribological property of diamond like carbon film at different humidity in air [J]. Tribology, 2005, 25(5): 426 - 430(in Chinese)[王成兵,李红轩,徐 洮. 相对湿度对类金刚石薄膜摩擦磨损性能的影响[J]. 摩 擦学学报,2005,25(5):426-430].